SI/3N НАНО ПРИБОРЫ: ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КРЕМНИЯ

 * В.И. Осинский l , В.А. Лабунов 2 , И.В. Масол l , Г.Г. Горох 2 , Н.Н. Ляхова l , Н.О. Суховий l

¹ГП «НИИ микроприборов» НТК «Институт Монокристаллов» НАН Украины, Украина, Киев, ул. Пивнично-Сирецька, 3.

е-mail: osinsky@imd.org.ua

²Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники БГУИР, Беларусь, 220013. Минск. П. Бровки. д. 6: e-mail: gorokh@bsuir.by

SI/3N NANODEVICES: THE SECOND COMING OF SILICON

*V.I. Osinskiy¹, V.A. Labunov², I.V. Masol¹, G.G. Gorokh², N.N. Laykhova¹, N.O. Sukhoviy¹

¹State Enterprise Research Institute of Microdevices STS «Institute for Single Crystals» of NAS of the Ukraine, Kiev, Pivnichna-Syretska str., 3, e-mail: osinsky@imd.org.ua

² Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Belarus, 220013, Minsk, Brovki Str. 6, e-mail: gorokh@bsuir.by

Development of new semiconductor A^{III}B^V-materials for light sources, optoelectronic ultrahigh-frequency and high-temperature devices is an actual task during last decades. Integration of electronic elements with regular A^{III}B^V-structures on Si leads to wide possibilities for invention of complex functional devices on a single cheap (Si/3N). Self-organized dielectric films, for example, porous anodic alumina are promising materials as a template for mounting of Si/3N nanodevices. The scientific approach of creation of new super bright white LEDs based on heterogeneous materials and nanoporous structures has been developed.

В последние годы исследовано большое количество технологий монолитной интеграции элементов на кремнии и соединениях A^3B^5 , в частности, на соединениях III-нитридов (3N). Однако, не достаточная эффективность, тепловые проблемы и относительно высокая стоимость создают существенные препятствия на пути их массового применения. Интеграция транзисторов на кремнии с гетеро структурами A^3B^5 позволяет создавать сложные функциональные однокристальные устройства (Si/A $^3B^5$). Несмотря на то, что первые одно чиповые устройства Si/A $^3B^5$ были предложены нами еще в 1972 году и реализованы в 1975 [1], поиск новых технологий активно продолжается [2, 3, 4, 5]. Особый интерес для кремниевых пластин больших диаметров представляет технология Al_2O_3 нанотемплетов из анодированного оксида алюминия (AOA), способству-

ющих уменьшению количества дефектов при эпитаксиальном наращивании новых слоев.

Темплеты АОА имеют размеры пор от десятков до сотен нанометров и представляют большой интерес при формировании электронных, оптоэлектронных и микромеханических нано размерных устройств, а также для создания одноэлектронных транзисторов и квантовых компьютеров, способных работать при комнатной температуре. Оптимальные параметры нано пор темплета способствуют бездислокационному рельефу новых эпитаксиальных слоев даже при большом рассогласовании решеток (~5 %).

На базе нано темплетов АОА нами разрабатывается светодиодная Si/A³B⁵ технология на основе монолитной интеграции RGB светодиодных структур и кремниевых интегральных микросхем. При изготовлении эпитаксиальных структур Si/A³B⁵ реализован комплекс методов селективных, латеральных и темплетных нанотехнологий, обеспечивающих низкую плотность дефектов в структурах. Предложен принцип создания новых супер ярких белых светодиодов на базе гетерогенных материалов и нано пористых структур. Такие светодиоды содержат инжектирующие и активные слои, сформированные из метастабильных фаз многокомпонентного твердого раствора (в частности, AlGaInNPAsSb) на базе варизонных структур с квантовыми ямами и точками [6].

Литература

- 1. Осинский В.И., Интегральный оптрон, А.С. №551.730 (СССР), Приоритет (1973)
- 2. Масол И.В., Осинский В.И., Сергеев О.Т. Информационные нанотехнологии, К. –Макрос, 2011. 500с.
- 3. Polyakov A. Y. et. al. Applied physics letters. 94(2) 022114 (2009).
- 4. Osinsky V., Murchenko D. Quantum electronics and Optoelectronics. 12(3) 240 (2009).
- 5. Osinsky V., Lyahova N., Syhoviy N., Deminskyi P. Memoirs of the Faculty of Physics 2 142304 (2014).
- Osinsky V., Osinsky A., Miller R. Proc. of the LED 50-th Anniversary Symposium, University of Illinois, USA. (2012).